

O B S A H :

str.:

Úvod	1
Rozvoj elektroniky a požadavky na materiálovou základnu R.Šorm, TESLA Praha	3
Význam a úloha dlouhodobého prognózování materiálové základny ve VHJ elektrotechnického průmyslu I.Hejtmánek, TESLA Rožnov	10
Příspěvek vedoucího pracoviště VTR pro oblast materiálů pro elektrotechniku k zabezpečení potřeb perspektivních materiálů L.Setnička, TESLA Praha	16
Program dalšího rozvoje polovodivých materiálů v TESLE VÚST O.Plajner, TESLA Praha	19
Materiály pro elektrotechniku vyráběné ve VÚK plynulým lítím P.Romaniak, VÚK Panenské Břežany	26
Vodivé komponenty tlustých odporových vrstev M.Frumar, L.Koudelka, VŠCHT Pardubice	28
Technické požadavky na používané a perspektivní mate- riály pro konstrukční součástky O.Kotoun, TESLA Jihlava	30
Nové materiály pro hybridní mikroelektroniku- R.Kužel, J.Broukal, MFF UK Praha, VÚ sklářský Hradec Králové	37
Kontaktní materiály z drahých a vysokotavitelných kovů O.Kobes, Safina Jesenice	39
Magneticky měkké kovové materiály a jejich aplikace v mě- řících a laboratorních přístrojích a zařízeních J.Filipenský, TESLA Brno	42
Permanentní magnety na bázi kovů vzácných zemin L.Kment, P.Novák, Z.Blažek, SVÚM Praha	48
Problematika přípravy kapalných chemikálií s potlačeným obsahem heterogenních nečistot K.Holemy, TESLA Rožnov	54
Molekulární elektronika S.Nešpůrek, ÚMCH ČSAV Praha	57
Ověřování chemikálií pro výrobu integrovaných obvodů v technologickém procesu J.Pěknica, TESLA Praha	63



Netradiční materiály pro přípravu tenkých vrstev chemickou reakcí z plynné fáze J.Gurovič, P.Fiskáček, K.Holeček, TESLA Praha	65
Nízkotlaké chemické usazování z par (LPCVD) uhlíku K.Balík, I.Brdička, TESLA Praha	68
Vliv organofunkčních silanů na vlastnosti epoxidových pryskyřic J.Makovička, ČKD Praha	70
Nové typy základních materiálů pro plošné spoje, určené k montáži integrovaných obvodů s plošnými vývody A.Martínek, TESLA Praha	72
Epoxidové materiály THEREPOX V.Jíšová, TESLA Praha	75
Modifikace měkkých pájek po strojním pájení v elektrotechnických závodech V.Poláková, A.Franěk, J.Havlíček, ČKD Polovodiče Praha	79
Metody přípravy, struktúra a vlastnosti disperzní spevneného striebra M.Basterci, M.Miškovičová, J.Luštík, Ústav experimentálnej metalurgie SAV, Košice	81
Zhodnocení elinvarových slitin systému FeNiCrTiAlSi J.Dubský, P.Chrástka, Ústav fyziky plazmatu ČSAV Praha, J.Křiva TESLA Praha, E.Královcová TESLA Praha	83
Modifikovaný materiál na bázi CuFe J.Kuneš, V.Komárek, VÚK Panenské Břežany	85
Výroba targetů pro magnetronové naprašování V.Souček, VÚK Panenské Břežany	88
Permanentní magnety se sbíhavou orientací P.Novák, Z.Blažek, L.Kment, SVÚM Praha	90
Nové typy kovových materiálů pro jádra magnetofonových hlav Z.Tischer, VÚK Panenské Břežany	92
Články s lithiovou anodou L.Hejlek, Bateria Slaný	94
Ferity pro mikrovlnné aplikace J.Šrámek, L.Ludera, TESLA Praha	96
Vlastnosti polovodičů $A_2^V B_3^{VI}$ a jejich technické aplikace J.Horák, P.Lošťák, VŠCHT Pardubice	98
Současný stav a perspektivy detektorů IC záření na bázi $Hg_{1-x}Cd_xTe$ P.Höschl, V.Prosser, M.Zvára, FÚ UK Praha	104



Zabezpečení vzácných zemin pro národní hospodářství F.Nekvasil, J.Slepička, ÚNS Kutná Hora	110
Použití vzácných zemin v elektronice a elektrotechnice J.Trebichovský, ÚNS Kutná Hora	112
Vzácné zeminy B.Rous, TESLA Rožnov	118
Současné a perspektivní materiály pro výrobu integrovaných obvodů na křemíkovém substrátu z pohledu technologa J.Pěknice, TESLA Praha	121
Příprava dichlorsilanu pro polovodiče J.Vošta, A.Slepánek, TESLA Rožnov	123
Amorfni chalcogenidové vrstvy - nové fotoresisty s vysokým rozlišením M.Frumar, J.Klikorka, VŠCHT Pardubice	125
Vysoce čistý polykrystalový křemík pro polovodiče D.Laskafeld, A.Slepánek, J.Vošta, L.Šalom, TESLA Rožnov	127
Nefunkční příměsi v křemíku D.Korytár, SAV Piešťany	131
Příprava monokrystalů křemíku s vysokou koncentrací příměsí J.Kadaňka, J.Stiller, TESLA Rožnov	133
Monokrystal Si legované dusíkem V.Smejkal, TESLA Rožnov	135
Moderní průmyslové technologie přípravy epitaxních struktur látek A <sup>III</sup> B <sup>V</sup> J.Stejskal, TESLA Praha	137
Perspektivy vývoje technologie molekulární epitaxe v ČSSR M.Lázníčka, J.Kejř, P.T.Dung, FzÚ ČSAV Praha, M.Cukr, TESLA Praha	139
Příprava GaAs epitaxních struktur pro mikrovlnné polovodičové součástky K.Hnilička, R.Hladina, TESLA Praha	141
Problémy přípravy epitaxních vrstev InGaAs na GaAs R.Kúdela, EÚ CEFV SAV Bratislava	143
Stanovenie stopových množstiev kovov diferenciálnou pulznou polarografiou M.Šingliar, A.Ležovič, VÚ pre petrochémiu, Prievidza	145
Využití hmotnostní spektrometrie sekundárních iontů v mikroelektronice P.Hedvábný, TESLA Praha	150
Elipsometrie jako kontrolní metoda pro materiály užívané v mikroelektronice I.Ohlídal, PŘF UJEP Brno	153

Dozimetrické vlastnosti materiálů luminiscenčních diod Z.Prášil, M.Šandera, L.Kokta, J.Trousil, ÚVAVR Praha	155
Plazmochemická reakce P.Schneider, TESLA Praha	158
Niektoré poznatky v materiálovej problematike forovoltiky S.Baratka, M.Ružinský, V.Šály, SVŠT Bratislava	160
Páskové profilované káble J.Švec, Kablo Bratislava	162
Keramická dielektrika pro mikrovlnnou elektroniku J.Schwarzbach, VÚEK Hradec Králové	164
Keramika z nitridu boritého - současný stav v ČSSR V.Brožek, V.Dufek, VŠCHT Praha	170
Teplně mechanické vlastnosti keramiky pro elektroniku V.Hanykř, Z.Trávníček, J.Trávníčková, VŠCHT Praha	176
Problémy výzkumu a vývoje past pro HfO <sub>2</sub> A.Kubový, F.Merunka, M.Merunka, VÚEK Hradec Králové	178
Skla pro povrchovou pasivaci polovodičových součástek J.Broukal, SVÚS Hradec Králové	184
Postery	186